

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年营业收入约 123.85 亿元，较 2024 年增加约 33.19 亿元，同比增长约 36.62%。

● 根据市场需求，公司加大研发力度，新产品数量快速增加。2025 年全年公司研发投入约 37.44 亿元，较 2024 年增长 12.91 亿元（增长约 52.65%），研发投入占公司营业收入比例约为 30.23%。

● 公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 21.11 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加约 4.96 亿元，同比增加约 30.69%。

● 公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 15.50 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加约 1.62 亿元，同比增加约 11.64%。

● 公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件的超高深宽比刻蚀工艺实现了稳定可靠的大规模量产。其中 CCP 方面，公司用于关键刻蚀工艺的单反应台介质刻蚀产品保持高速增长，能够全面覆盖存储器刻蚀应用中各类超高深宽比需求；ICP 方面，适用于下一代逻辑和存储客户用 ICP 刻蚀设备和化学气相刻蚀设备开发取得了良好进展，加工的精度和重复性已达到单原子水平。到 2025 年底，公司累计已有超过 7,800 个反应台在国内外 170 余条客户芯片及 LED 生产线全面量产，其中刻蚀设备反应台全球累计出货超过 6,800 台。公司的 CDP

产品部门为先进存储器件和逻辑器件开发的 LPCVD, ALD 等十多款导体和介质薄膜设备已经顺利进入市场，并且设备性能完全达到国际领先水平，薄膜设备的覆盖率不断增加。公司 EPI 设备研发团队已经开发出具有自主知识产权及创新的平台，目前减压 EPI 设备已付运成熟制程客户进行量产验证，该种设备同时也付运至先进制程客户进行验证，部分先进工艺已进入量产验证阶段；新一代高选择比预清洁腔体满足先进工艺的需求，已在客户端进行量产验证；常压外延设备现已完成开发，进入工艺验证阶段。在泛半导体设备领域，公司正在开发更多化合物半导体外延设备，已陆续付运至客户端进行验证。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	1,238,463.83	906,516.51	36.62%
营业利润	219,051.09	170,351.78	28.59%
利润总额	218,984.94	170,893.47	28.14%
归属于母公司所有者的净利润	211,147.30	161,567.57	30.69%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	154,979.64	138,815.34	11.64%
基本每股收益（元）	3.40	2.61	30.19%
加权平均净资产收益率	9.98%	8.66%	增加 1.37 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	2,977,230.19	2,621,754.47	13.56%
归属于母公司的所有者权益	2,269,461.68	1,973,691.23	14.99%
股本	62,614.53	62,236.37	0.61%
归属于母公司所有者	36.24	31.71	14.29%

的每股净资产（元）			
-----------	--	--	--

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

公司 2025 年营业收入约 123.85 亿元，较 2024 年增加约 33.19 亿元，同比增长约 36.62%。其中，2025 年刻蚀设备销售约 98.32 亿元，同比增长约 35.12%；LPCVD 和 ALD 设备销售约 5.06 亿元，同比增长约 224.23%。

2025 年归属于母公司所有者的净利润约 21.11 亿元，较上年同期增加 30.69%，主要原因如下：（1）2025 年营业收入增长 36.62%下，毛利较去年增长约 11.28 亿元。（2）由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长，2025 年公司加大研发力度，以尽快弥补国产半导体设备短板，积极赶超，为长期持续增长打好基础。2025 年公司研发投入约 37.44 亿元，较去年增长 12.91 亿元，同比增长约 52.65%，2025 年研发投入占公司营业收入比例约为 30.23%，远高于科创板均值。2025 年研发费用 24.75 亿元，较去年增长约 10.58 亿元，同比增长约 74.61%。（3）由于二级市场股价波动以及公司出售了部分持有的上市公司股票，经评估师评估，公司 2025 年计入非经常性损益的股权投资收益为 6.07 亿元，较上年同期的股权投资收益 1.98 亿元增加约 4.09 亿元。

2025 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 15.50 亿元，较上年同期增加 11.64%，本期增长的主要原因：由于 2025 年营业收入增长 36.62%，毛利较去年增长约 11.28 亿元，以及 2025 年研发费用较去年增长约 10.58 亿元。

于报告期末，公司总资产约 297.72 亿元，较报告期初增加 13.56%；归属于母公司的所有者权益约 226.95 亿元，较报告期初增加 14.99%。

2、影响经营业绩的主要因素

公司主营产品等离子体刻蚀设备作为半导体前道核心设备之一，市场空间广阔，技术壁垒较高。公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，

先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现量产。

公司在新产品开发方面取得了显著成效，近两年新开发出十多种导体和介质薄膜设备，目前已有多款新型设备产品进入市场，其中部分设备已获得重复性订单，LPCVD 设备累计出货量突破三百个反应台，其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进；公司 EPI 设备已顺利进入客户端量产验证阶段。

公司持续保持国际氮化镓基 MOCVD 设备市场领先地位，积极布局用于碳化硅和氮化镓功率器件应用的市场，并在 Micro-LED 和其他显示领域的专用 MOCVD 设备开发上取得了良好进展，几款 MOCVD 新产品进入客户端验证阶段。公司新型八寸碳化硅外延设备、新型红黄光 LED 应用的设备已付运至国内领先客户开展验证，目前进展顺利。

公司在南昌约 14 万平方米的生产和研发基地、上海临港约 18 万平方米的生产和研发基地已经投入使用，保障了公司销售快速增长。公司持续开发关键零部件供应商，推动供应链稳定、安全，设备交付率保持在较高水准，设备的及时交付也为公司销售增长提供有力支撑。公司特别重视核心技术的创新，始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入，同时公司运营管理水平持续提升，对产品成本及运营费用的控制能力有效增强。

（二）财务指标增减变动幅度达 30% 以上的主要原因说明

营业收入较上年同期增长 36.62%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 30.69%，主要受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势。公司 2025 年营业收入约 123.85 亿元，较 2024 年增加约 33.19 亿元，同比增长约 36.62%，其中刻蚀设备销售约 98.32 亿元，同比增长约 35.12%；LPCVD 和 ALD 设备销售约 5.06 亿元，同比增长约 224.23%。

三、风险提示

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年2月28日